

平面显示器制程应用



制程

环境工况

Fluorez®
FFKM

Fluorez®
FKM



电浆制程

PECVD/PVD

RF, SiH₄, N₂O, N₂, NH₃, PH₃
Ar, N₂, H₂, NF₃, Al₂O₃, O₂

FU650N

FU750N

FU800W

干式蚀刻

CF₄, C₃F₈, CHF₃, SF₆, O₂, H₂,
HBr, BCl₃, CCl₄, Cl₂

玻璃清洗

IPA, H₂O

FC750W

HFV70
PFV75

光刻

H₂SO₄, NaOH, TMAH, NMP,
PGMEA, PGME, EBR, n-BA

FC750W

FC750B

FP675
FPA75
PFV75

湿式蚀刻

HNO₃, HF, H₃PO₄, H₂O₂
Acetic acid

光刻剥离

MEA, DMSO, BDG

FC750W

FC750B

FPA75
FP675

聚酰亚胺

Acetone, NMP

FP675

玻璃基板传送

Ethanol, IPA, Rollar Mark free

FC750W



湿制程